

ionPOWDER¹⁰⁰

Niederdrucksystem, ausgestattet mit Ionenimplantationstechnologien für die Behandlung von Pulvern und losen Teilen

Die ionPOWDER-Anlage ermöglicht die Oberflächenbehandlung von Pulvern mit einer doppelten Niederdrucktechnologie: Ionenimplantation mit unserem ionGUN 2000, der neue und verbesserte Oberflächeneigenschaften erzeugt.



Designed by ionics

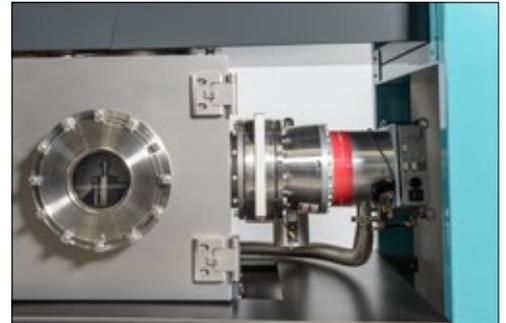
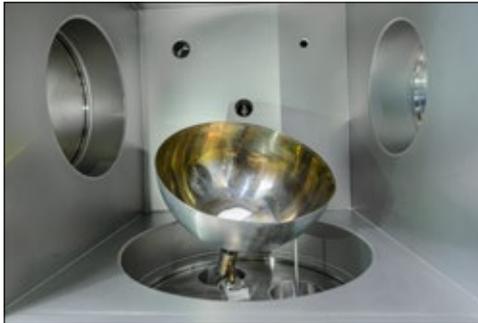
TECHNISCHE DATEN	
Stromversorgung	Allgemeine Leistung: 400 V / 32 A Frequenz: 10 GHz / 50 W Leistung: bis zu 600 W Ionenenergie: bis zu 40 kV Ionenstrom: bis zu 15 mA
Druckbereich	10 ⁻⁶ mbar
Anzahl der verwendeten ionGUN's	1
Substratgröße	von wenigen Mikrometern bis zu einigen Zentimetern
Verarbeitungskapazität	Chargen bis zu 500 ml
Abmessungen der Maschine	L2600xB900xH2500 mm
Gewicht	750 kg
Wasser-Kühlsystem	Ja – demineralisiertes Wasser

Eigenschaften

- ▲ Beschichtungsquellen: Ionenimplantation - auch PVD auf Anfrage erhältlich
- ▲ Vollständig integriertes automatisches Kontrollsystem
- ▲ Jedes Gas kann verwendet werden: Ar, He, N₂, O₂, SiH₄ sowie Mischungen

Option

- ▲ 1 kreisförmige PVD-Kathode (2-Zoll / 51 mm) + Stromversorgung



Anwendungen

▲ Auf Pulvern/Diamanten

Pulvermodifikation für AM, 3D-Druck, Katalysatoren, Spritzguss und Sinterverfahren, thermisches Spritzen,...

▲ Auf Fasern

Behandlung von Fasern für Verbundwerkstoffe, Filtration, GO-Polymere und Batterien.

▲ Auf losen Teilen/Kugeln

Behandlung loser Teile für neue Oberflächenfunktionalitäten und verbesserte Haltbarkeit.

Die Innovation wird von der Wallonische Region durch das Walibeam-Projekt unterstützt, an dem wichtige industrielle Akteure auf dem Gebiet der Oberflächenbehandlung von Glas, Metall und Polymer beteiligt sind.